

2027年3月期第2四半期

決算説明会

日本電子株式会社

2026.11.19

INDEX

1. 2027年3月期第2四半期実績および通期予想
2. 各事業の状況 および ビジネストピックス
3. 中期経営計画（Evolving Growth 2.0 -A New Horizon-）の進捗と戦略

1. 2027年3月期第2四半期実績および通期予想

2026年度第2四半期決算サマリー

2026年度 2Q実績

- 売上高は上期公表を上回って着地した一方、営業利益が公表を下回り、前年比減収減益となった
  【売上高】　658億円 (前年比 △19.8%)
  【営業利益】　52億円 (同 △56.5%)
- 受注高は過去3番目、受注残高は過去2番目の高水準となり、いずれも前年同期実績を大きく上回った
- 理科学・計測機器事業：増収増益 / 製品ミックス改善と円安（為替）により、上期としては過去最高の営業利益・営業利益率・粗利率を達成
- 産業機器事業：減収減益 / マルチビームマスク描画装置およびシングルビームマスク描画装置の売上減少により前年同期比で減収となったものの、スポットビームの受注拡大が継続

2026年度 通期見通し

- 事業毎に濃淡があるものの、引き続き、通期公表の達成を目指す
  【売上高】　1,640億円 (前年比 △8.6%)
  【営業利益】　265億円 (同 1.9%)
- 理科学・計測機器事業：米国の科学技術予算動向や米中貿易摩擦に加え、中東情勢等の地政学的リスクの高まりなどにより不透明な事業環境が継続だが、電子顕微鏡を中心に前期を上回る収益を見込む
- 産業機器事業：スポット型電子ビーム描画装置は旺盛な需要が継続する見通し、マルチビームマスク描画装置は顧客の先端半導体向け設備投資再開の動きを背景に需要回復の兆し、シングルビームマスク描画装置の引き合いも堅調

2026年度第2四半期決算実績（P/L）

■売上高 658億円 (前年比 △19.8%)、営業利益 52億円 (同 △56.5%)

連結数値（P/L）

（単位：億円）

	25 年度 2Q実績 ①	26 年度 2Q実績 ②	前年比 ②－①
1 売上高	821	658	△ 162
2 売上原価	428	328	△ 100
3 （原価率）	52.1%	49.8%	△ 2.3%
4 売上総利益	393	330	△ 63
5 販管費	214	228	14
6 研究開発費	59	51	△ 9
7 販売費及び一般管理費合計	273	278	5
8 営業利益	119	52	△ 67
9 営業外収益	11	11	0
10 営業外費用	1	10	9
11 経常利益	129	53	△ 76
12 特別利益	10	2	△ 8
13 特別損失	0	0	0
14 税前当期純利益	139	55	△ 84
15 法人税等	40	22	△ 18
16 当期純利益	99	32	△ 66
為替レート(1$=)	¥147	¥160	
為替レート(1€=)	¥168	¥184	

営業利益増減要因分析（対 前年比）

（単位：億円）

(A)プラス要因	48
1. 為替差 (円安)	27
2. 原価改善等	11
3. 研究開発費減	9
(B)マイナス要因	△ 115
1. 売上数量減	△ 101
2. 販売管理費増	△ 14
(A)+(B)	**△67**

事業セグメント別連結売上高・営業利益の推移（第2四半期累計期間）

（単位：億円）

		25 年度 2Q実績①	26 年度 2Q実績②	増減 (②－①)	増減率
全　社	売　上　高	821	658	△ 162	△ 19.8%
	営 業 利 益	119	52	△ 67	△ 56.5%
	営業利益率	14.5%	7.9%	△ 6.7%	—
	経 常 利 益	129	53	△ 76	△ 58.9%
	当 期 純 利 益	99	32	△ 66	△ 67.4%
理科学・計測機器事業	売　上　高	477	509	32	6.8%
	営 業 利 益	27	50	22	81.0%
	営業利益率	5.8%	9.8%	4.0%	—
産業機器事業	売　上　高	270	149	△ 121	△ 44.7%
	営 業 利 益	117	38	△ 79	△ 67.3%
	営業利益率	43.2%	25.5%	△ 17.6%	—
医用機器事業	売　上　高	74	—	△ 74	—
	営 業 利 益	7	—	△ 7	—
	営業利益率	9.4%	—	—	—
全　社	費　　用	32	36	4	12.6%
	為替レート(1$=)	¥147	¥160	¥13	9.2%
	為替レート(1€=)	¥168	¥184	¥17	9.9%

2026年度予想（P/L）

■26年度の通期予想は変更なし

■売上高 1,640億円 (前年比 △8.6%)、営業利益 265億円 (同1.9%)

連結数値（P/L）

（単位：億円）

	24 年度 通期実績	25 年度 通期実績 ①	26 年度 通期予想 ②	前年比 ②－①
1 売上高	1,967	1,794	1,640	△ 154
2　売上原価	1,043	963	814	△ 149
3　（原価率）	53.0%	53.7%	49.6%	△ 4.1%
4 売上総利益	924	830	826	△ 4
5　販管費	449	456	456	0
6　研究開発費	120	114	105	△ 9
7　販売費及び一般管理費合計	569	570	561	△ 9
8 営業利益	355	260	265	5
9 経常利益	344	286	262	△ 24
10 当期純利益	187	221	213	△ 8
為替レート(1$=)	¥152	¥151	¥155	
為替レート(1€=)	¥164	¥175	¥175	

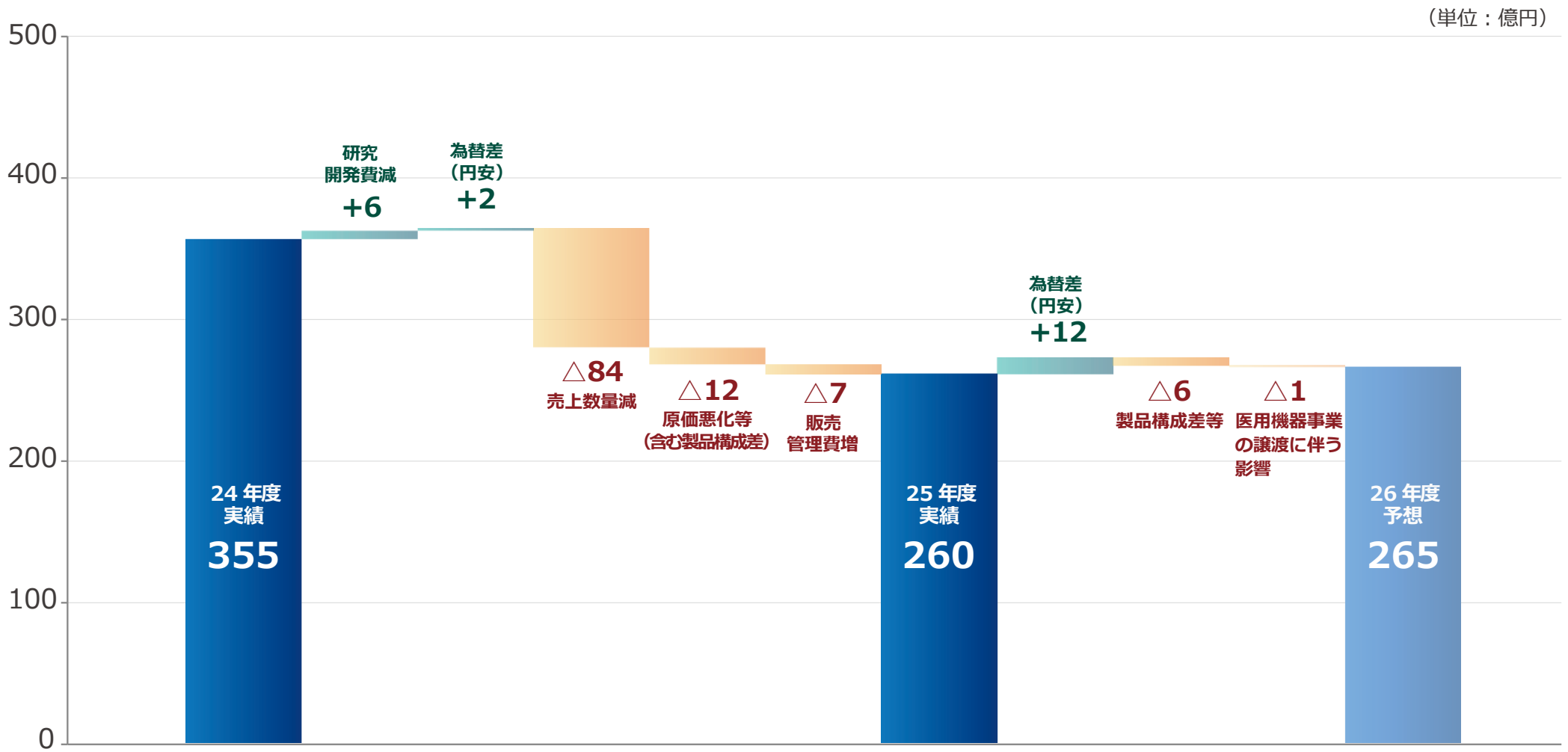
営業利益増減要因分析（対 前年比）

（単位：億円）

(A)プラス要因	12
1. 為替差 (円安)	12
(B)マイナス要因	△ 7
1. 製品構成差等	△ 6
2. 医用機器事業の譲渡に伴う影響	△ 1
(A)+(B)	**5**

利益の増減要因

営業利益増減分析



事業セグメント別連結売上高・営業利益の推移（通期予想）

（単位：億円）

		25 年度 通期実績①	26 年度 通期予想②	増減 （②－①）	増減率
全　社	売　上　高	1,794	1,640	△ 154	△ 8.6%
	営 業 利 益	260	265	5	1.9%
	営業利益率	14.5%	16.2%	1.6%	—
理科学・計測機器事業	売　上　高	1,163	1,214	51	4.4%
	営 業 利 益	131	164	33	25.2%
	営業利益率	11.2%	13.5%	2.3%	—
産業機器事業	売　上　高	481	426	△ 55	△ 11.4%
	営 業 利 益	194	167	△ 27	△ 13.9%
	営業利益率	40.2%	39.3%	△ 0.9%	—
医用機器事業	売　上　高	149	—	—	—
	営 業 利 益	1	—	—	—
	営業利益率	0.4%	—	—	—
全　社	費　　用	65	67	2	3.1%
	為替レート(1$=)	¥151	¥155	¥４	2.6%
	為替レート(1€=)	¥175	¥175	¥０	—

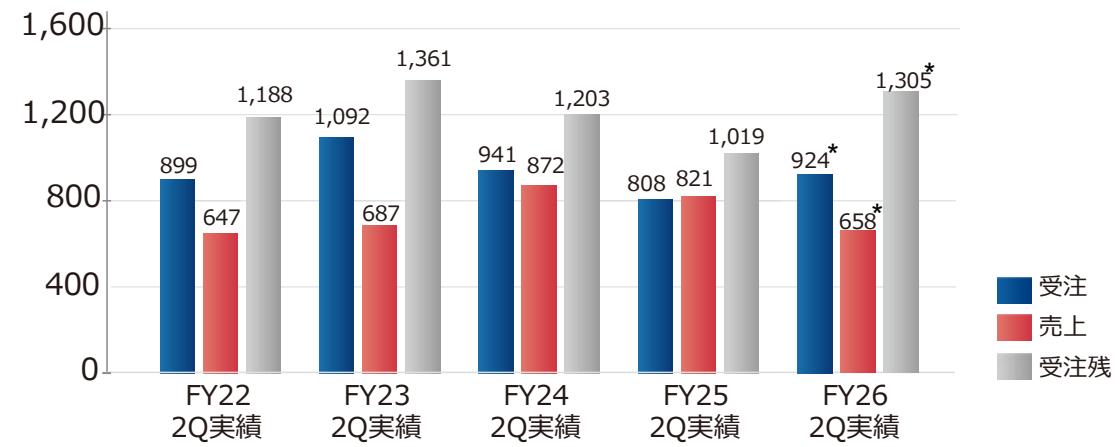
主要勘定の推移

第２四半期

（単位：億円）

（連結）	24年度 2Q実績	25年度 2Q実績	26年度 2Q実績
1 在庫	822	798	803
2 有利子負債（リース負債等を含む）	126	69	113
3 純資産 (自己資本比率)	1,316 (57.3%)	1,438 (63.5%)	1,458 (64.7%)
4 配当金（円）	44 円	53 円	66 円
5 海外売上比率	76.4%	73.2%	73.8%
6 受 注	941	808	924*
7 受注残	1,203	1,019	1,305*

第2四半期連結受注 / 売上 / 受注残推移



＊ 医用機器事業は当期より対象外（事業譲渡による）

通期

（単位：億円）

（連結）	24年度 通期実績	25年度 通期実績	26年度 通期予想
1 在庫	770	755	647
2 有利子負債（リース負債等を含む）	93	271	198
3 総資産	2,225	2,420	2,461
4 純資産 (自己資本比率)	1,367 (61.4%)	1,449 (59.9%)	1,590(64.6%)
5 配当金（円）	106円	132円	132 円
6 設備投資	70	202	230
7 減価償却費	49	54	65
8 連結受注高	1,864	1,801	1,750*
9 連結期末受注残	1,032	1,039	1,100*
10 海外売上比率	71.2%	67.2%	68.0%

＊ 医用機器事業は当期より対象外（事業譲渡による）

資本効率に係る指標

1 ROE	14.3%	15.7%	14.0%
2 ROIC※	18.5%	12.3%	11.2%
3 PBR	1.7 倍	1.9 倍	—

※社内管理基準に基づく

事業環境

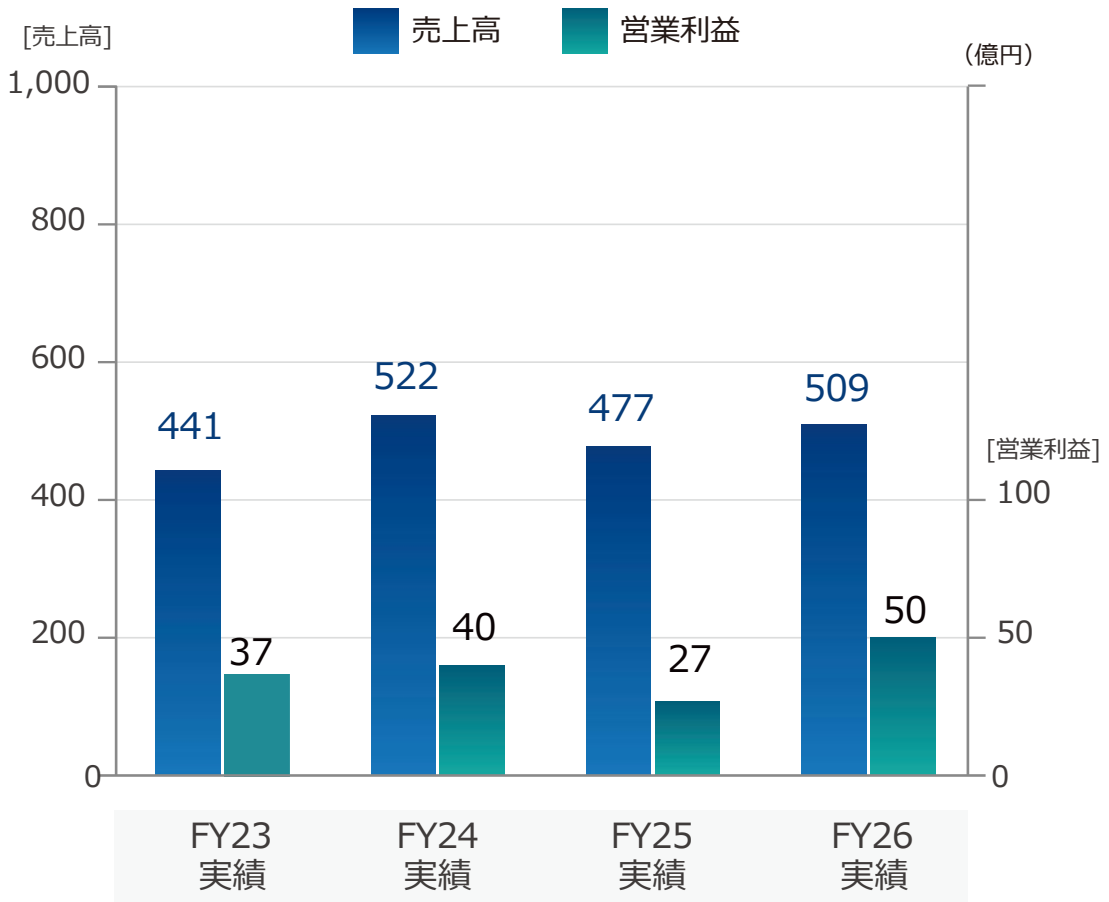
■理科学・計測機器事業：重点分野である半導体・ライフサイエンスを成長ドライバーとして更なる事業拡大を推進
■産業機器事業：マルチビームマスク描画装置の需要回復、AIデータセンター向け光トランシーバー需要増に応えるスポット型電子ビーム描画装置の事業拡大

理科学・計測機器事業	大学／官庁	■日本：科学技術投資は堅調、補正予算（研究基盤整備案件）に期待 ■米国：アカデミック市場は慎重姿勢継続、防衛・AI・量子・半導体関連は堅調 ■欧州：米国同様の傾向が続く一方、先行き不透明感は継続 ■中国：需要は一定水準を維持する一方、補正予算の一巡や輸出管理厳格化の影響により先行きは不透明 ■アジア：中東情勢などの地政学リスクはあるものの、研究開発投資は総じて堅調に推移
	民需（半導体）	■微細化・積層化の進展に伴い、歩留まり改善に不可欠なFIB・TEMの重要性が一段と高まる
	民需（他産業）	■ライフサイエンス市場へ積極的な販促展開 ■内外製造業の研究開発投資は堅調
産業機器事業	描画装置	■マルチビームマスク描画装置：顧客投資再開の動きを背景に需要回復の兆しが顕在化 ■シングルビームマスク描画装置：輸出規制強化や中国需要一巡の影響を受けるも、成熟ノード向けを中心に底堅い需要が継続 ■スポットビーム（スポット型電子ビーム描画装置）：AIデータセンター向け光トランシーバー需要の拡大を背景に、DFBレーザーの高性能化・多様化が進展し、旺盛な需要が継続

2. 各事業の状況 および ビジネストピックス

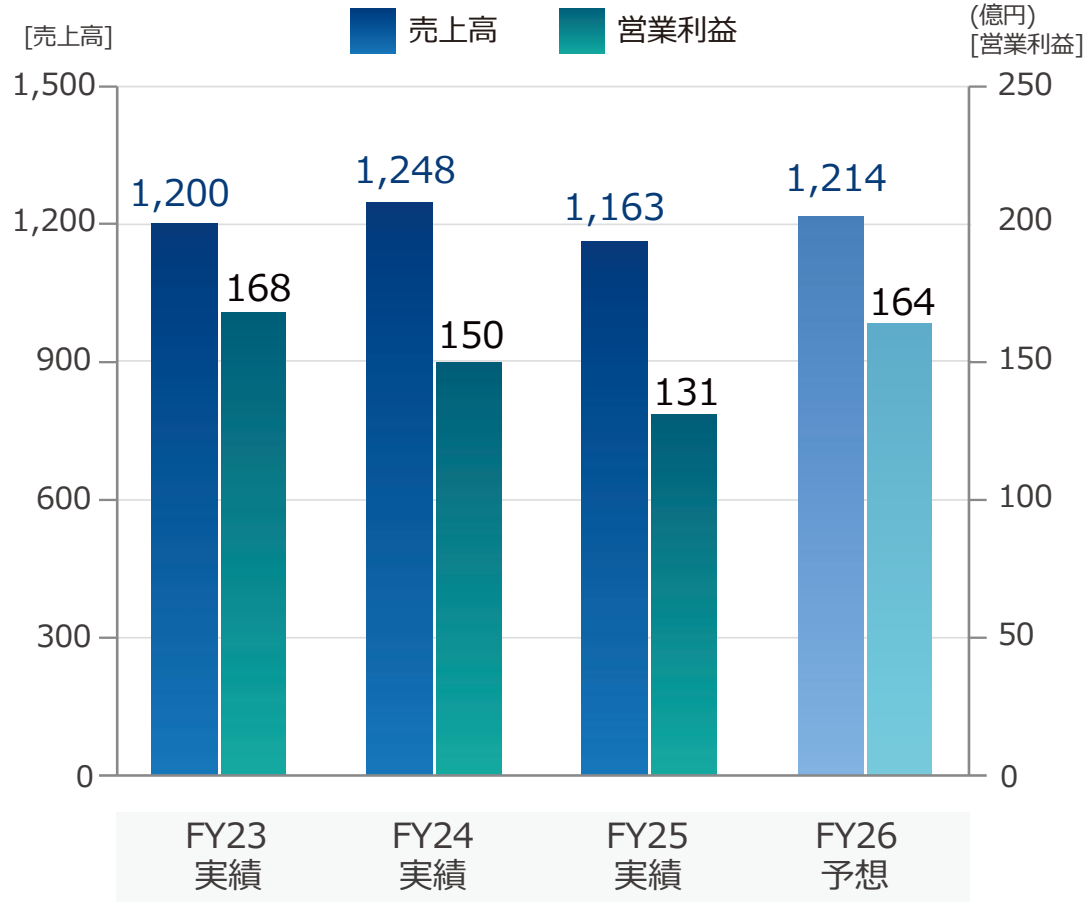
理科学・計測機器事業　　売上高・営業利益の推移

第２四半期業績推移



	FY23 実績	FY24 実績	FY25 実績	FY26 実績
為替レート(1$=)	¥ 141	¥ 152	¥ 147	¥ 160
為替レート(1€=)	¥ 154	¥ 165	¥ 168	¥ 184

通期業績推移



	FY23 実績	FY24 実績	FY25 実績	FY26 予想
為替レート(1$=)	¥ 144	¥ 152	¥ 151	¥ 155
為替レート(1€=)	¥ 157	¥ 164	¥ 175	¥ 175

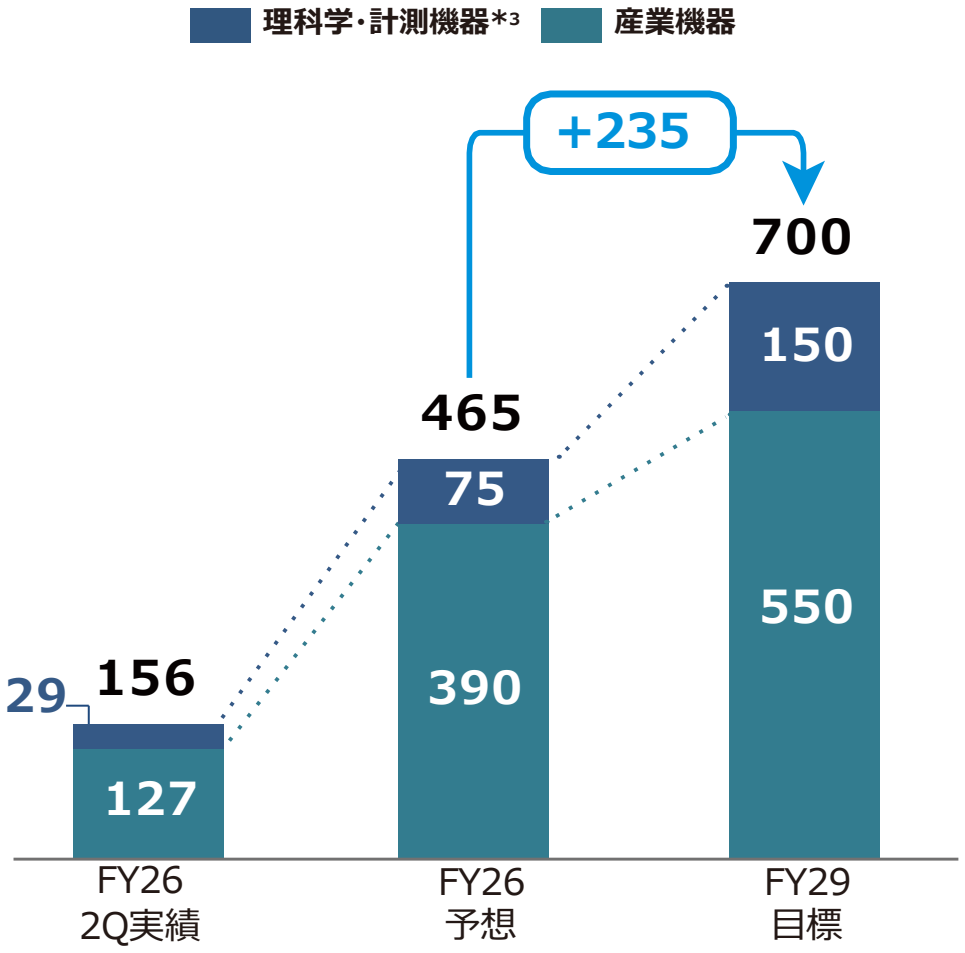
重点領域【半導体】売上・利益目標

■ 半導体領域*1は、FY29 売上高700億円(FY25比+195億円)、営業利益280億円*2(同+82億円)を目指す

事業戦略のポイント

半導体の技術変化	顧客課題	JEOLの提供価値	対象製品
GAA／CFET等、次世代デバイス構造の高度化・複雑化が進展	構造／欠陥の可視化・解析の難易度が上昇、解析負荷が増大	FIB/TEMによる高精度断面作製・構造解析、自動化・AI解析により効率性を向上	FIB（JIB-PS500i） TEM（ACE eye™） SEM（JSM-IT810シリーズ）
先端露光の進展（High-NA化）	微細化に伴うマスク精度の高度化と高スループットへの期待	10Å世代対応MBMWによる高精度・高スループット化の実現	MBMW
AIデータセンター拡大に伴う光通信需要の増大	DFBレーザー量産化ニーズの高まり	高性能スポットビーム描画装置による市場ニーズへの対応	JBX-8100FS

半導体分野　売上高の実績と目標（億円）



注：　*1 理科学・計測機器事業と産業機器事業の内、半導体業界の顧客向け
*2 全社費用配賦後、社内管理基準に基づく
*3 重点製品（JEM-ACE200F、JIB-PS500i、JSM-IT810シリーズ等）が対象

半導体｜当社関連製品

■ 当社製品は、半導体の開発から製造の様々な場面で利用され、高い信頼性から不可欠な存在

集積回路製造工程

液中不純物検査 MS

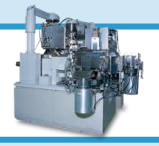


LSI設計

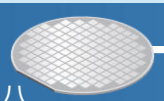
フォトマスク作製 MBMW



シングルビーム
マスク描画装置



前工程

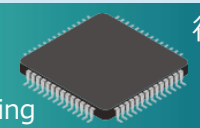


ウェハ

洗浄 → 成膜 → 露光 → 現像・エッチング → イオン注入 → 検査

繰り返し

後工程



Packaging

プロセスモニタリング (検査)

形状測定（膜厚 / 寸法測定）等

TEM



FIB



半導体構造の微細化・複雑化の進展により、CD-SEM市場の一部がTEM/FIBを用いた検査に

オフライン解析

加工条件評価、故障解析

SEM



JSM-IT810シリーズ



HAXIS



LazEdge™

光通信デバイス製造（AIサーバー用途等）

DFBレーザー素子

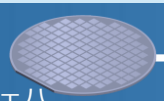
回折格子
パターニング

スポット型
電子ビーム描画装置



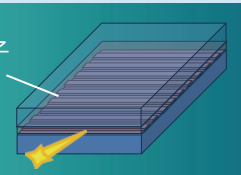
製作工程

化合物
半導体ウェハ



レジスト塗布 → 電子ビーム描画 → 現像 → 格子形成
(エッチング) → 再成長 → 電極形成 → チップ化

回折格子



単一波長レーザー出力

先端半導体プロセス、デバイス開発

TEM　FIB　SEM

AES　NMR　スポット型 電子ビーム描画装置

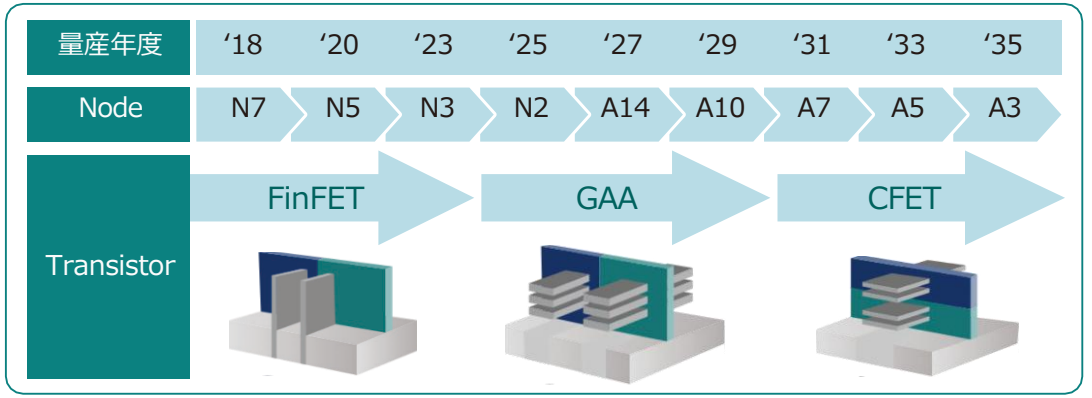
新　構　造　開　発：新トランジスタ形状の開発、加工条件の導出、応力の分布、欠陥の有無
膜　材　料　開　発：膜質、膜厚、プロセス条件の導出、欠陥準位の有無
多　層　配　線　開　発：材料開発、コンタクトホールなど構造
ﾌｫﾄﾚｼﾞｽﾄ材料開発他：高解像度、感度向上、環境負荷低減

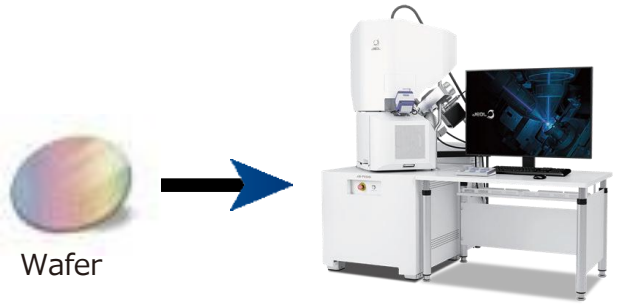
半導体｜プロセスモニタリング向けソリューション（前工程）

■微細化・積層化の進展に伴い、歩留まり改善に不可欠なFIB・TEMの重要性が一段と高まる

■主要顧客での評価は順調に進展しており、中長期的な需要拡大を見込む







Wafer

JIB-PS500i

FIB-SEMシステム
（集束イオンビーム加工観察装置）

試料作製

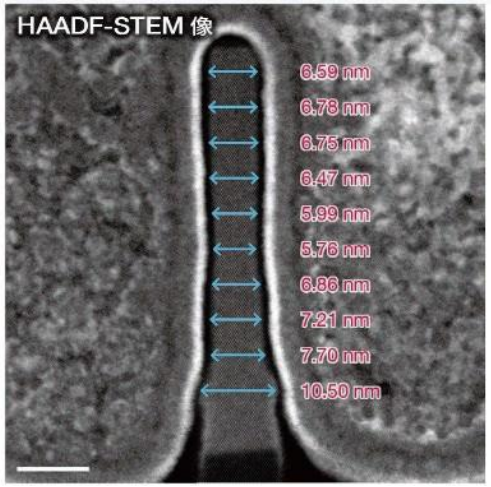




ACE eye™

半導体向けTEM
（ハイスループット解析電子顕微鏡）

構造形状計測



FinFET (Fin Field-Effect Transistor) 型トランジスタのHAADF-STEM 像の測長例

半導体｜QC/FA向けソリューション（後工程）

■微細化・積層化の進展に伴い、先端パッケージングなどの後工程でも計測需要が拡大

■接合界面や材料、微細構造、欠陥など、観察・分析すべき対象が増加し、より高精度で高度な解析が求められる

Non-destructive testing

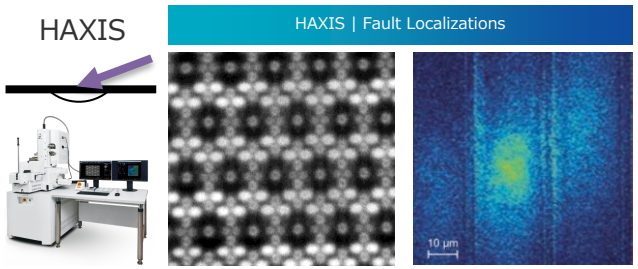
Preparation
Device Decapsulation
Device Delayering

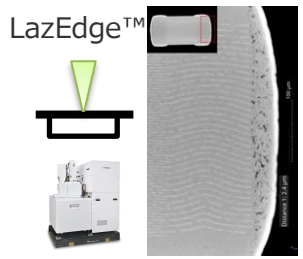
Fault Isolation
Fine milling
Passive Voltage Contrast

Physical analysis
Imaging
Analysis

X ray CT

Emission microscope





Delayering and PVC imaging

Low-angle Ar Ion Milling processing

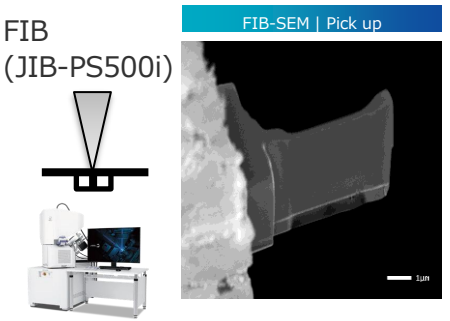
Decapsulation

Femtosecond laser processing

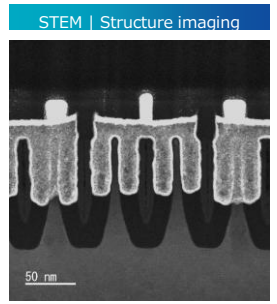
Analysis

sampling

Ga Ion processing







mm level
Resolution of Accuracy

um level

nm level

Atomic level

中計重点分野における新製品戦略

■ 重点分野である「半導体」「ライフサイエンス」を中心に、今年度の新製品投入を通じ、成長基盤を拡充

製品価値の進化（向上）

既存製品の性能・操作性・生産性を高め、顧客価値と継続的な更新需要を創出

ACE eye™
ハイスループット解析電子顕微鏡 (TEM)
半導体｜AIによる自動化・高スループット化

2026年8月発売

GRAND ARM™ 3
原子分解能分析電子顕微鏡 (TEM)
その他｜原子レベル解析を高度化

2026年8月発売

NeoScope™ | JCM-7000PLUS
卓上走査電子顕微鏡 (SEM)
その他｜操作性・解析効率を向上

2026年9月発売

競争力強化

市場ニーズを踏まえた性能・機能向上により、競争優位性の確立とシェア拡大を推進

CRYO ARM™ 300S／200S
クライオ電子顕微鏡 (TEM)
ライフサイエンス｜処理能力を向上

2026年8月発売

Super COOL Marvel HCN
生体高分子研究向け高感度極低温NMRプローブ
ライフサイエンス｜高感度・短時間化

2026年8月発売

新市場創出

独自技術を活用した革新的な製品により、新たな市場機会を創出し、将来の事業領域と収益機会を拡大

LazEdge™
レーザー加工SEMシステム
半導体・電池・金属｜大面積加工解析領域を開拓

2026年5月発売

HAXIS
LIM (Low-angle Ion Milling) - SEM
半導体｜故障箇所の絞り込み工程に新たな解析手法を提供

2026年10月発売

※各製品は複数の目的に寄与しますが、本資料では主たる戦略目的で整理しています。

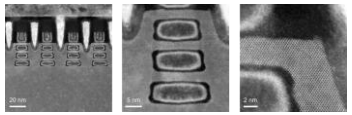
ACE eye™ ｜ ハイスループット解析電子顕微鏡 (TEM)

2026年8月発売

■ 半導体プロセス解析の更なる自動化・高スループット化を実現

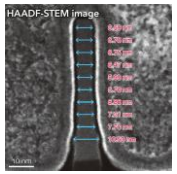


LAADF-STEM images (Sample: Gate-All-Around)



Specimen : Semiconductor device (GAA)
Accelerating voltage : 200 kV

HAADF-STEM image (CD Measurement)



Specimen : Semiconductor device (FinFET)
Accelerating voltage : 200 kV

顧客課題

半導体の微細化・高集積化に伴い、検査・解析のさらなる高速化と安定化が求められている

提供価値

1. AI活用によりTEM/STEM観察からEDS分析まで自動実行
2. 無人連続測定により解析効率を向上
3. 高分解能観察と高感度分析を両立

事業機会 ｜ ロジック・メモリなど先端半導体のプロセスモニタリング需要の拡大に対応

主な顧客

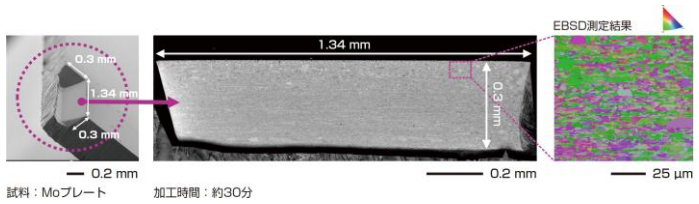
- 先端半導体メーカー
- 半導体装置メーカー
- 半導体材料メーカー
- 分析・故障解析会社

LazEdge™ ｜ レーザー加工SEMシステム

2026年5月発売

■ 半導体故障解析および大気非暴露が求められる電池解析分野において、大面積断面解析の新たな市場を創出





顧客課題

半導体、電池、金属分野において、大面積領域を対象とした高速・高精細加工を求める解析ニーズに幅広く対応

提供価値

1. 当社SEMに浜松ホトニクス社製のレーザー技術を融合による高精細・広領域（ミリスケール）断面の高速加工
2. レーザー加工時のデブリ抑制による高品質な観察・分析
3. 加工から分析までのシームレスなワークフロー

事業機会　|金属試料解析をはじめ、高速断面加工を必要とする半導体の故障解析、大気非暴露を必要とする電池解析など、幅広いニーズに貢献

主な顧客　半導体メーカー　電池メーカー　金属メーカー　分析・故障解析会社

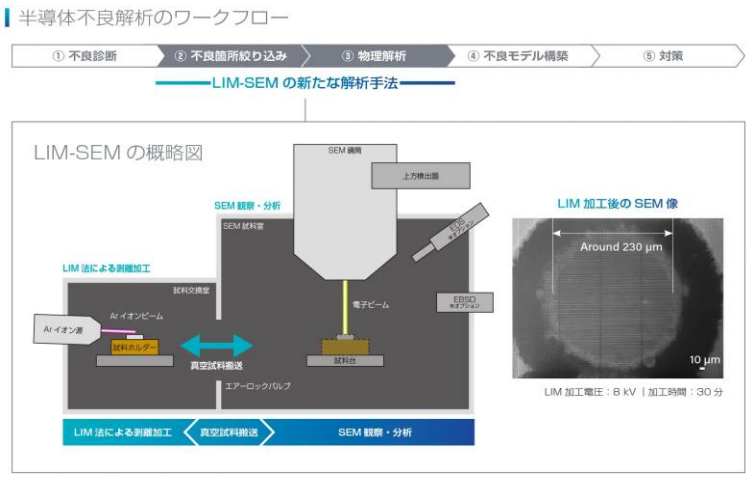
HAXIS ｜ LIM (Low-angle Ion Milling) - SEM

2026年10月発売

■ 半導体故障解析における不良箇所特定プロセスへ、新たな解析手法を提供



半導体不良解析のワークフロー



顧客課題

先端半導体の微細回路では、ナノマニピュレータによる接触・測定が困難となり、効率的な故障解析手法が求められている

提供価値

1. 独自の低角度イオンミリング（LIM）技術により、試料ダメージを抑えながら高品質な断面を形成
2. PVC（Passive Voltage Contrast）観察により、先端半導体デバイスの不良箇所を可視化
3. 加工と観察を繰り返す逐次解析により、試料内部の欠陥箇所を効率的に特定

事業機会 ｜ ロジック・メモリなど先端半導体における故障解析需要の拡大

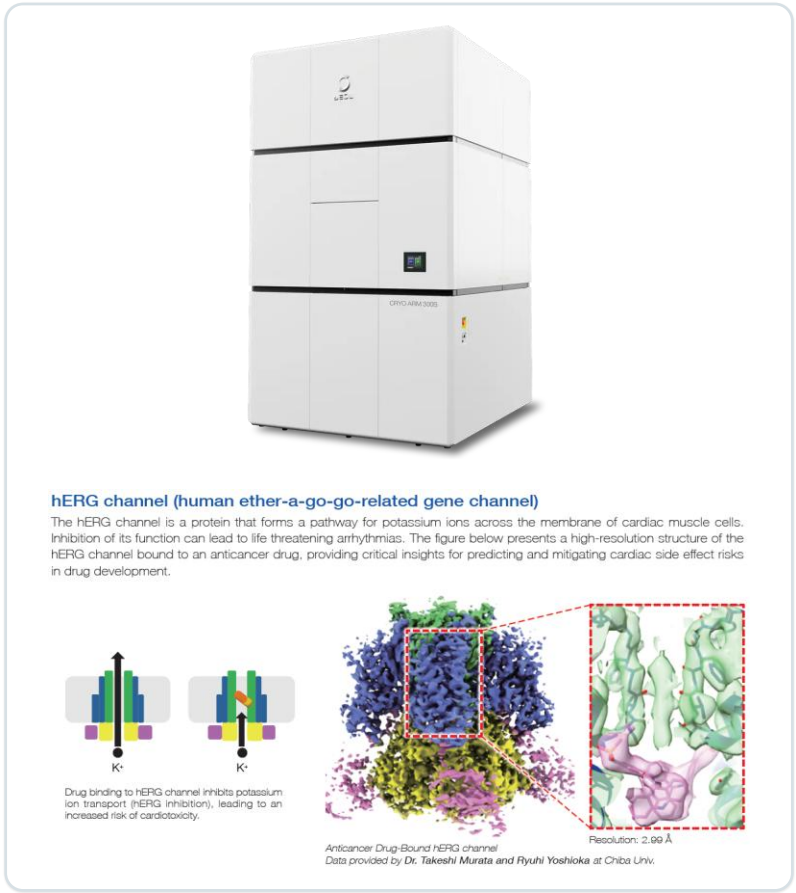
主な顧客

- 先端半導体メーカー
- 半導体装置メーカー
- 半導体材料メーカー
- 分析・故障解析会社

CRYO ARM™ 300S／200S ｜ クライオ電子顕微鏡 (TEM)

2026年8月発売

■ 創薬・構造生物学研究の生産性向上



顧客課題

タンパク質や薬剤候補の構造解析を効率化し、創薬研究の期間短縮につなげたい

提供価値

1. AIが撮影箇所を自動検出。半日程度の作業を**約1時間へ短縮**
2. 試料装填数を4個から6個へ増加し、**搬送回数を削減**
3. 実運用ベースで1時間当たり約1,000枚の画像取得を実現（**画像取得スピード従来比約2倍**）

事業機会 ｜ 構造解析を活用した創薬研究の拡大を捉え、製薬企業・研究機関におけるクライオ電子顕微鏡の導入・活用機会を拡大

主な顧客　製薬会社　バイオ企業　大学・研究機関

SuperCOOL MARVEL HCN ｜ 高感度極低温NMRプローブ

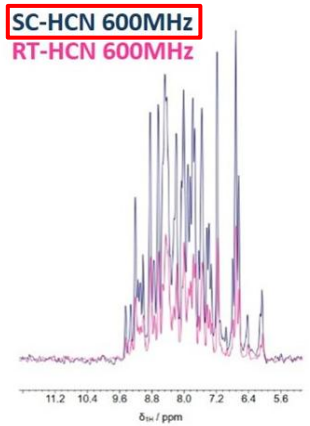
2026年8月発売

■ 高感度化と測定時間短縮により、生体高分子・バイオ医薬品研究を効率化

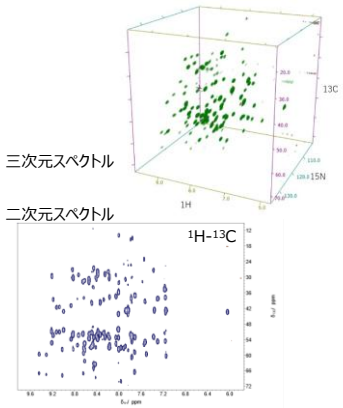
■新開発の高感度極低温NMRプローブ



■従来比2～3倍の感度向上



■タンパク質構造解析例



顧客課題

バイオ医薬品研究における微量試料の高感度測定と測定時間短縮

提供価値

1. タンパク質、ペプチド、核酸などの生体分子試料を対象としたNMR測定に優れた性能を発揮
2. 室温HCNプローブと比較して**約2～3倍の感度向上**を実現
3. 測定時間が、**1/4**の時間に短縮（既存自社プローブ比）
4. 液体窒素冷却方式により**低運用コスト**を実現

事業機会 ｜ バイオ医薬品の研究開発向け需要拡大

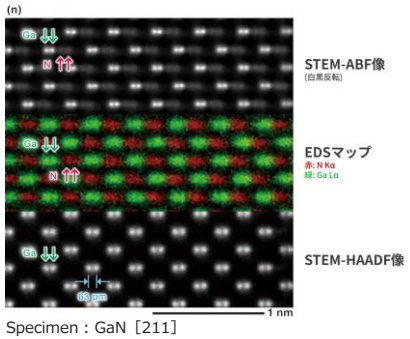
主な顧客　製薬会社　バイオ企業　大学・研究機関

GRAND ARM™ 3 ｜ 原子分解能分析電子顕微鏡 (TEM)

2026年8月発売

■ 超高分解能・高精度分析と高速観察により、原子レベルの動的現象解析を実現





Specimen : GaN［211］

顧客課題

原子レベルの構造・元素情報に加え、材料の変化や反応をリアルタイムで捉えたい

提供価値

1. **超高分解能観察**（LASCOR／ATCORにより、STEM・TEMの両モードで高分解能を実現）
2. **高感度元素分析**（大収束角とDual SDDにより、高プローブ電流と原子スケール分析を両立）
3. **動的現象の可視化**（高速スキャンにより、原子レベルのその場観察や反応追跡を可能に）

事業機会 ｜ 半導体・電池・触媒など、先端材料の構造解析・その場観察ニーズに対応

主な顧客　大学・研究機関　先端材料メーカー　製造業

NeoScope™ ｜ JCM-7000PLUS　卓上走査電子顕微鏡 (SEM)

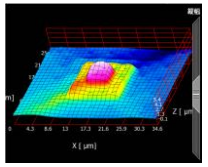
2026年9月発売

■ 操作性・解析効率の向上により、品質管理・研究開発の効率化



Live機能がさらに進化

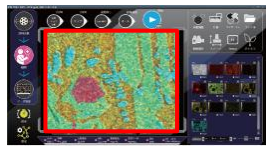
Live 3D



Live Analysis



Live Map

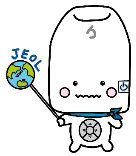


Live Report



Live Particle





顧客課題

品質管理・研究開発の現場において、観察・解析業務の迅速化と操作性向上へのニーズが高まっている

提供価値

1. **画質向上**（入射電圧20kVを採用し、分解能が向上）
2. 簡便な操作性はそのままに、**２つの新規Live機能**（Live Reportを追加し、作業効率が向上）
3. 幅広い産業の材料・異物・表面観察に対応

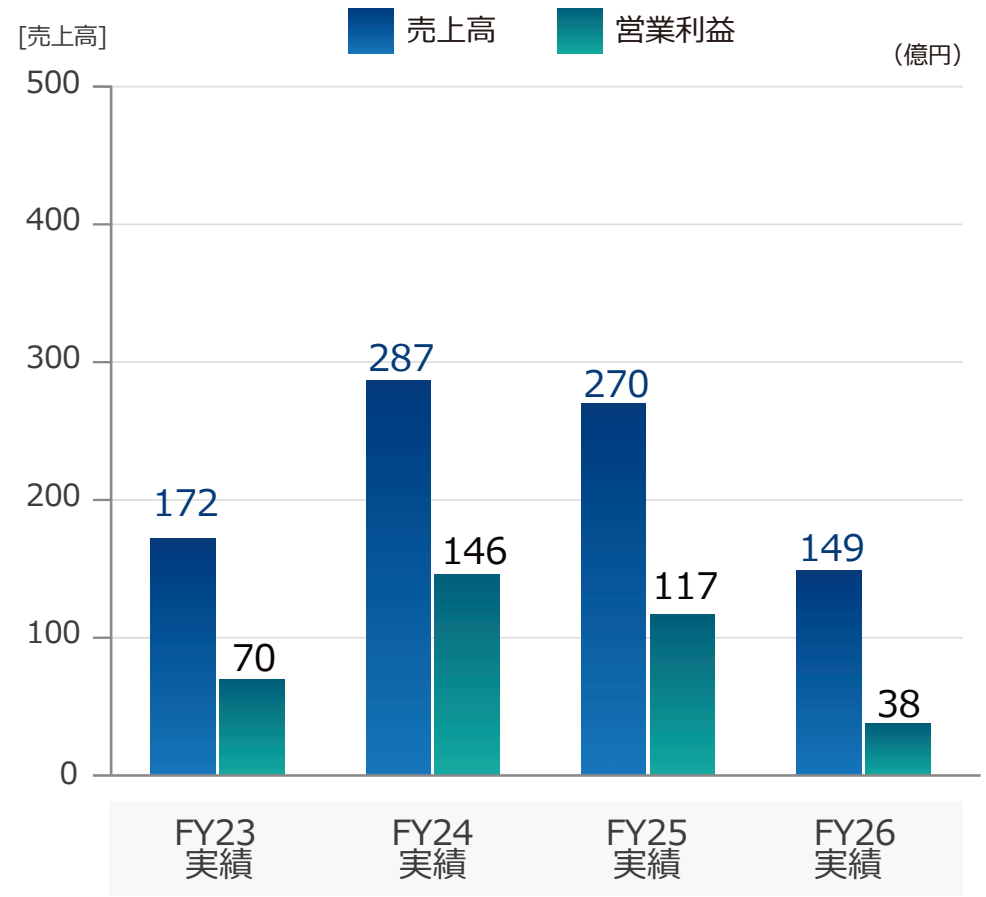
   化学、鉄鋼、機械、食品、非鉄金属、電気・電子などの製造業に加え、
   教育・公的試験研究・受託分析の現場で活用

事業機会 ｜ 研究開発・品質管理現場などにおける業務効率化

主な顧客　製造業　大学・研究機関　分析・調査会社

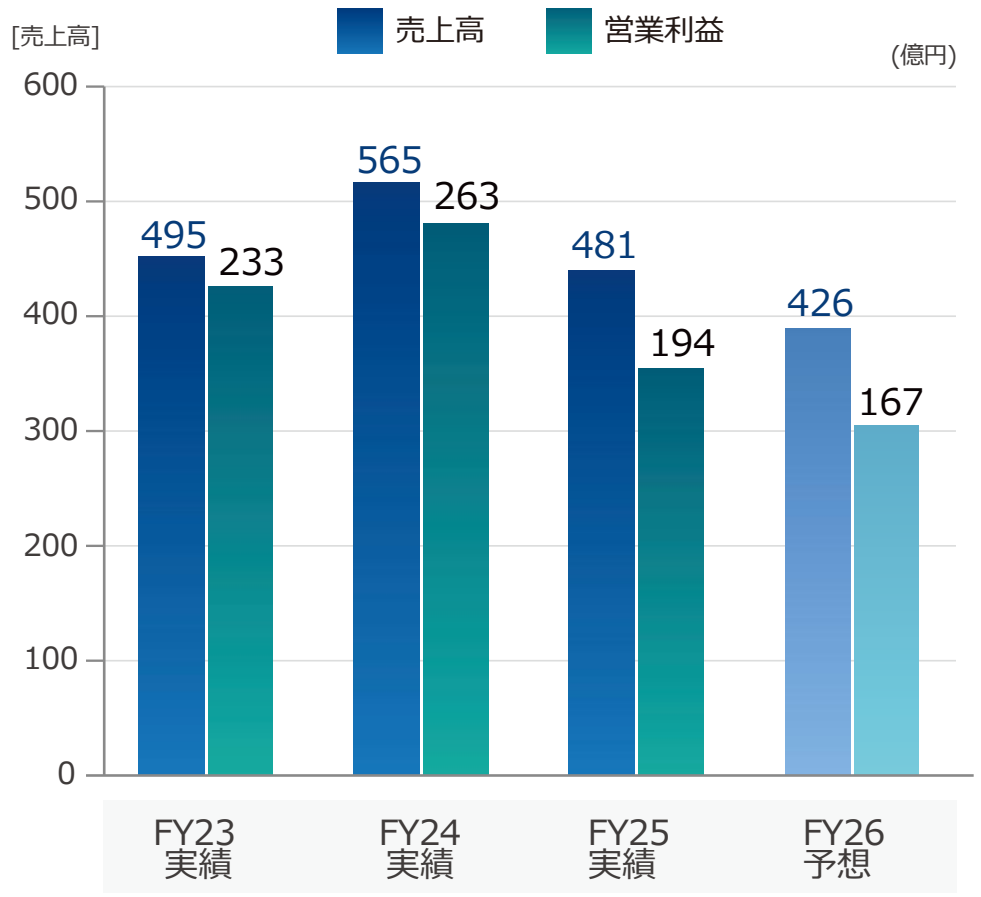
産業機器事業　　売上高・営業利益の推移

第２四半期業績推移



	FY23 実績	FY24 実績	FY25 実績	FY26 実績
為替レート(1$=)	¥ 141	¥ 152	¥ 147	¥ 160
為替レート(1€=)	¥ 154	¥ 165	¥ 168	¥ 184

通期業績推移



	FY23 実績	FY24 実績	FY25 実績	FY26 予想
為替レート(1$=)	¥ 144	¥ 152	¥ 151	¥ 155
為替レート(1€=)	¥ 157	¥ 164	¥ 175	¥ 175

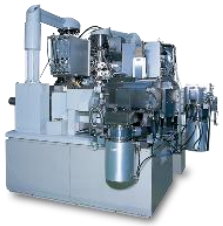
電子ビームマスク描画装置

- マルチビームマスク描画装置：顧客投資再開の動きを背景に需要回復の兆しが顕在化、次世代12インチマスク対応製品の開発を開始
- シングルビームマスク描画装置：輸出規制強化や中国需要一巡の影響を受けるも、成熟ノード向けを中心に一定の需要が継続

UV (i-Line, Krypton, Fluoride) | DUV (Argon fluoride) | EUV

Laser Writer

Single-Beam Mask Writer



JBX-3050MV/S



JBX-3200MVS

Multi-Beam Mask Writer









350nm — 90nm

150nm — 32nm

45nm — 7nm — 3nm — 2nm — Angstroms

Solutions for Innovation JEOL

電子ビーム描画装置(スポットビーム)

■ AIデータセンター向けDFBレーザー*の需要拡大を背景に、スポットビームの需要が好調に推移

AIデータセンター需要の拡大

生成AIの普及・モデル高度化・処理データ量の増加

SCALE OUT

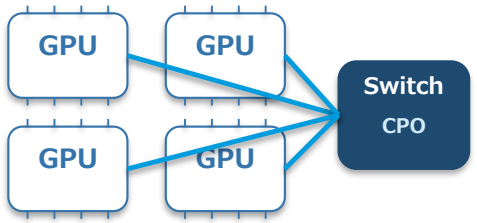
ラック間の接続



- AIクラスタ大型化
- ラック間通信量増加
  プラガブル光トランシーバーによる柔軟な接続拡張
- スイッチ層の高速伝送
  ToR(トップ・オブ・ラック)スイッチからCPO導入が進展

SCALE UP

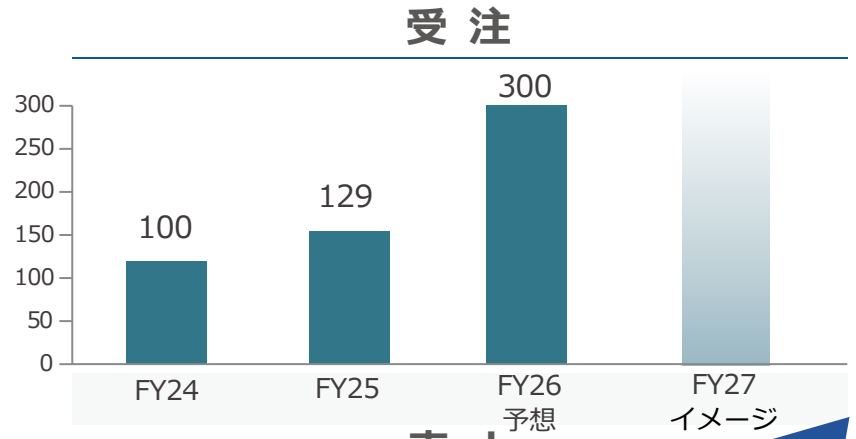
ラック内の接続

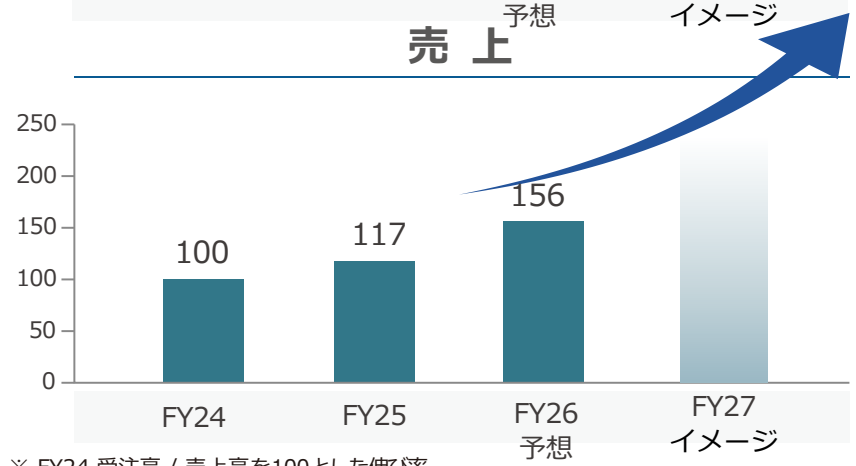


- GPU性能向上
- GPU間通信量増加
- 光接続比率上昇
  銅配線からCPOへ移行

光接続

光トランシーバー搭載数・光源数の増加 → DFBレーザー需要が拡大





※ FY24 受注高 / 売上高を100とした伸び率

光接続の増加

GPU間・ノード間の
高速光接続が拡大

光トランシーバー需要増

プラガブル／CPOの進展で
搭載数量が増加

DFBレーザー搭載数増

チャネル数・光源数の
増加が数量成長を牽引

DFBレーザー需要拡大

AIインフラ投資の拡大が
光デバイス市場の成長機会に



スポット型電子ビーム描画装置
JBX-8100FS

*DFBレーザー：波長安定性に優れ、大容量・長距離光通信に用いられる半導体レーザー。EML（電界吸収型変調器付きレーザー）の構成部品であり、CPO向け光源としても活用が期待される

Solutions for Innovation JEOL

3. 中期経営計画（Evolving Growth 2.0 -A New Horizon-）の進捗と戦略

ビジョン 2035



*半導体、ライフサイエンス等重点市場での、シェアトップクラスを目指すことを意味する

中期経営計画 (Evolving Growth 2.0 -A New Horizon-) の進捗

理科学・計測機器事業

- 外部環境の不透明感は継続するものの、重点領域である半導体およびライフサイエンス分野において、コアプロダクトの拡販と複数の新製品投入を通じた成長戦略を推進しており、中期経営計画は概ね計画どおり進捗

産業機器事業

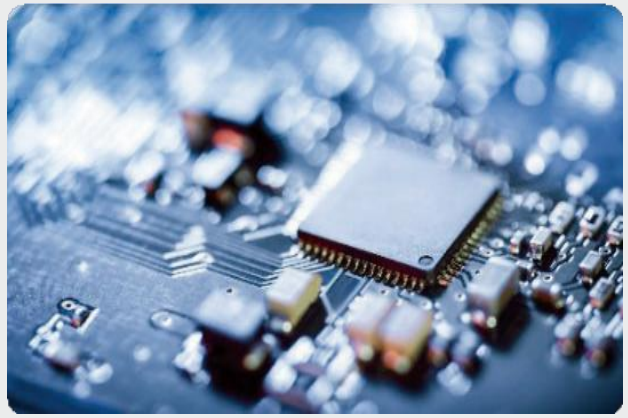
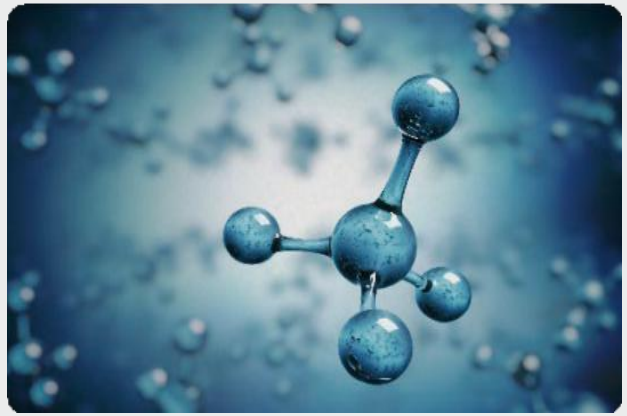
- マルチビームマスク描画装置は需要回復の兆しが顕在化。シングルビームマスク描画装置は成熟ノード向けを中心に底堅く推移し、スポットビーム描画装置はAI関連需要を背景に好調を維持しており、中期経営計画は概ね計画どおり進捗

「Evolving Growth 2.0 -A New Horizon-」サマリー

ビジョン2035	最先端テクノロジーに挑戦するお客様とイノベーションを共創する、グローバルリーダー*になる *半導体、ライフサイエンス等重点市場での、シェアトップクラスを目指すことを意味する
数値目標 (FY29)	売上高：2,050億円、営業利益：440億円（営業利益率21.5%)、ROE：15%以上、ROIC：15%以上
YOKOGUSHI 2.0	「YOKOGUSHI」を「YOKOGUSHI 2.0」に進化させ、3軸 (①機器/機能、②アプリケーション/サービス、③共創)での革新・拡張を通じて、高い付加価値創出による分野別ソリューションを強化
戦略・施策	資本効率を重視した経営とコア事業の「稼ぐ力」を強化 1. 高い市場成長性が見込まれ、かつ当社グループの持つニッチなテクノロジーが活用できる半導体・ライフサイエンスの分野を重点領域に設定し、この分野での成長を実現することにより、理科学・計測機器事業における収益性を向上 2. 技術革新や新しいビジネスモデルの開発により競争力を強化し、イノベーション創出を通じて市場でのポジションを確立し、多様な社会課題への解決に貢献 3. 重点市場である海外（米国・欧州・アジア）において、重点領域である半導体およびライフサイエンス分野へのサポート体制強化や販促投資を進め収益性を向上 4. 顧客満足度の向上や従業員エンゲージメントの強化を図り、イノベーションの推進とガバナンスの強化を通じて、持続可能な成長を実現 5. 工程の最適化を軸とした生産性向上戦略により、工期短縮と原価低減を実現し、競争力を強化
株主還元	目標配当性向30%を目安とし、資本効率の向上と企業価値の持続的な成長を実現するため株主還元を強化すると共に、当面は成長に向けた戦略的な投資をより重視する方針

本中計での重点領域

■市場成長が見込まれ、当社の高い技術力が必要な半導体とライフサイエンスを重点領域とする

	半導体	ライフサイエンス
		
市場の成長	半導体の微細化・高密度化と需要増に伴い、高度な計測検査装置市場が大幅伸長の見込	ライフサイエンス市場の成長に伴い、そこで用いられる分析装置の市場も伸長の見込
当社の強み	半導体構造解析および欠陥解析に必要な高精度な機器・サービスを提供。お客様の手間を減らすよう、測定の自動化にも取組む	構造生物学や創薬向けに、原子レベルの分子構造解析を可能にする高精度な装置とサービスを提供

中期経営計画の目標【財務】

■持続的な成長に向け、資本効率を重視した経営とコア事業の「稼ぐ力」をさらに強化
■資本効率向上のため、ROE・ROICの目標を設定してPDCAサイクルでフォローアップ

		FY24 実績	FY25 実績	FY26 予想	FY29 目標	成長率 (FY24-29)	施策
収益性の向上	売上高	1,967億円	1,794億円	1,640億円	2,050億円	CAGR 0.8%	•イノベーションの創出 •重点領域強化
	営業利益	355億円	260億円	265億円	440億円	CAGR 4.4%	
	営業利益率	18.0%	14.5%	16.2%	21.5%	+3.5%pt	
	為替レート(1$=)	¥152	¥151	¥155	¥145		
	為替レート(1€=)	¥164	¥175	¥175	¥157		
資本コストを上回るリターンの創出	ROE	14.3%	15.7%	14.0%	15%以上	—	•収益性改善と資産の効率化 •株主還元強化
	ROIC*	18.1%	12.3%	11.2%	15%以上	—	

*社内管理基準に基づく

中期経営計画の目標【財務】｜セグメント別

■半導体・ライフサイエンスを重点領域とし、独自技術を活用して理科学・計測機器の収益性を向上。営業利益率を+7.1pt改善（12.0%→19.1%）

営業利益率を＋7.1%改善		主な施策	KPI
重点領域向け売上増	+4.1pt	・戦略製品(半導体向けFIB/TEM等)売上増による製品ミックス改善 ・価格規律の強化および製品価値に基づく価格戦略による粗利率の向上	重点領域(半導体等)向け売上、粗利率
サービス収支改善	+1.5pt	・保守契約率の向上 ・高付加価値サービスの拡大および価格マネジメント強化 ・サービスオペレーションの効率化	保守契約率、粗利率
生産性収支改善	+1.5pt	・工場再編・スマートファクトリー化・工期短縮等による生産効率の向上	原価率、工期

■マルチビームの市況回復を期待、スポットビーム特需への対応強化

		FY24実績	FY25実績	FY26予想	FY29目標	成長率(FY24-29)
理科学・計測機器事業	売上高	1,248億円	1,163億円	1,214億円	1,440億円	CAGR 2.9%
	営業利益	150億円	131億円	164億円	275億円	CAGR 12.9%
	営業利益率	12.0%	11.2%	13.5%	19.1%	+7.1%pt
産業機器事業	売上高	565億円	481億円	426億円	610億円	CAGR 1.5%
	営業利益	263億円	194億円	167億円	230億円	CAGR △2.6%
	営業利益率	46.6%	40.2%	39.3%	37.7%	△8.9%pt
医用機器事業	売上高	154億円	149億円	–	–	–
	営業利益	7億円	1億円	–	–	–
	営業利益率	4.3%	0.4%	–	–	–
全社費用		65億円	65億円	67億円	65億円	
	為替レート(1$=)	¥152	¥151	¥155	¥145	
	為替レート(1€=)	¥164	¥175	¥175	¥157	

バランスシートマネジメント方針

■資本コストや株価を意識した経営の推進により、中期経営計画における企業価値向上を推進する

資本コストを意識した最適資本構成

- ■ 企業価値の持続的な成長に向けて、資本コストや株価を意識した経営を推進
- ■ 適切な自己資本比率、D/Eレシオを見極め、資本コストを上回るリターンの創出を図る
- ■ 様々な事業局面における必要な現預金保有水準の検討を進める

投資規律を重視

- ■ 半導体、ライフサイエンス領域の重点投資を実施するとともに、投資効率を重視した成長投資を推進
- ■ 戦略投資(M&A等) は規律を持って判断、戦略投資の機会がない場合は、追加の株主還元を検討

株主還元を強化

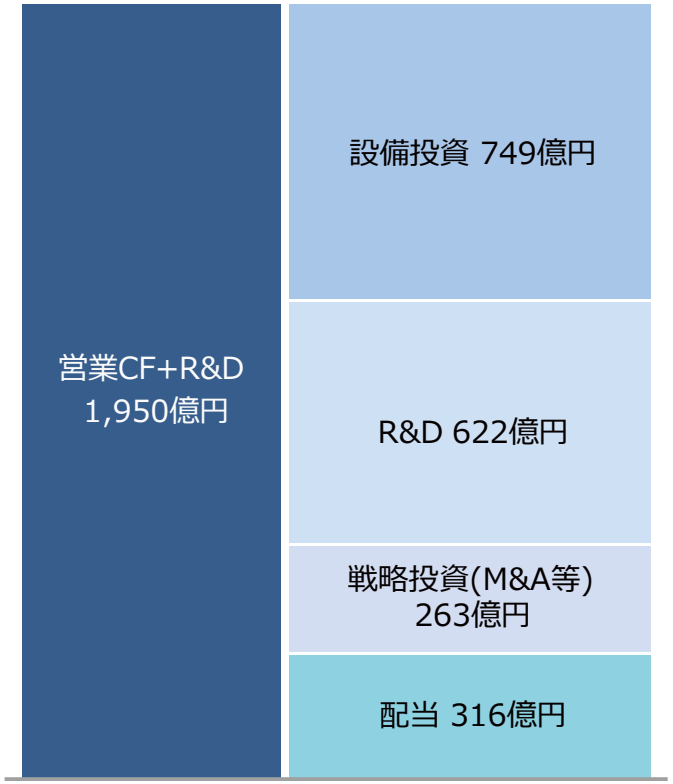
- ■ 配当性向30%を目安とし、安定的かつ継続的な株主還元が基本方針
- ■ 自己株式取得は資本効率の向上、企業価値の持続的な成長に向けて機動的な実施を検討
  (26年3月期に118億円(230万株) の自己株式取得を実施)
- ■ 取得した自己株式については、M&A•役職員向け株式報酬等への活用可能性を踏まえつつも、過度な保有は資本効率を低下させるとの認識のもと、一定水準を超える部分については消却を検討する

キャッシュアロケーション

■ 医用機器事業譲渡による中期経営計画の見直しを踏まえ、更なる企業価値向上に向けたキャッシュアロケーションを設定

■ 重点領域への成長投資と共に株主還元も強化、M&Aも視野に入れた戦略投資は規律を持って判断

当初計画
(FY25-FY29)



修正計画 (26年5月修正)
Evolving Growth 2.0 -A New Horizon- (FY25-FY29)

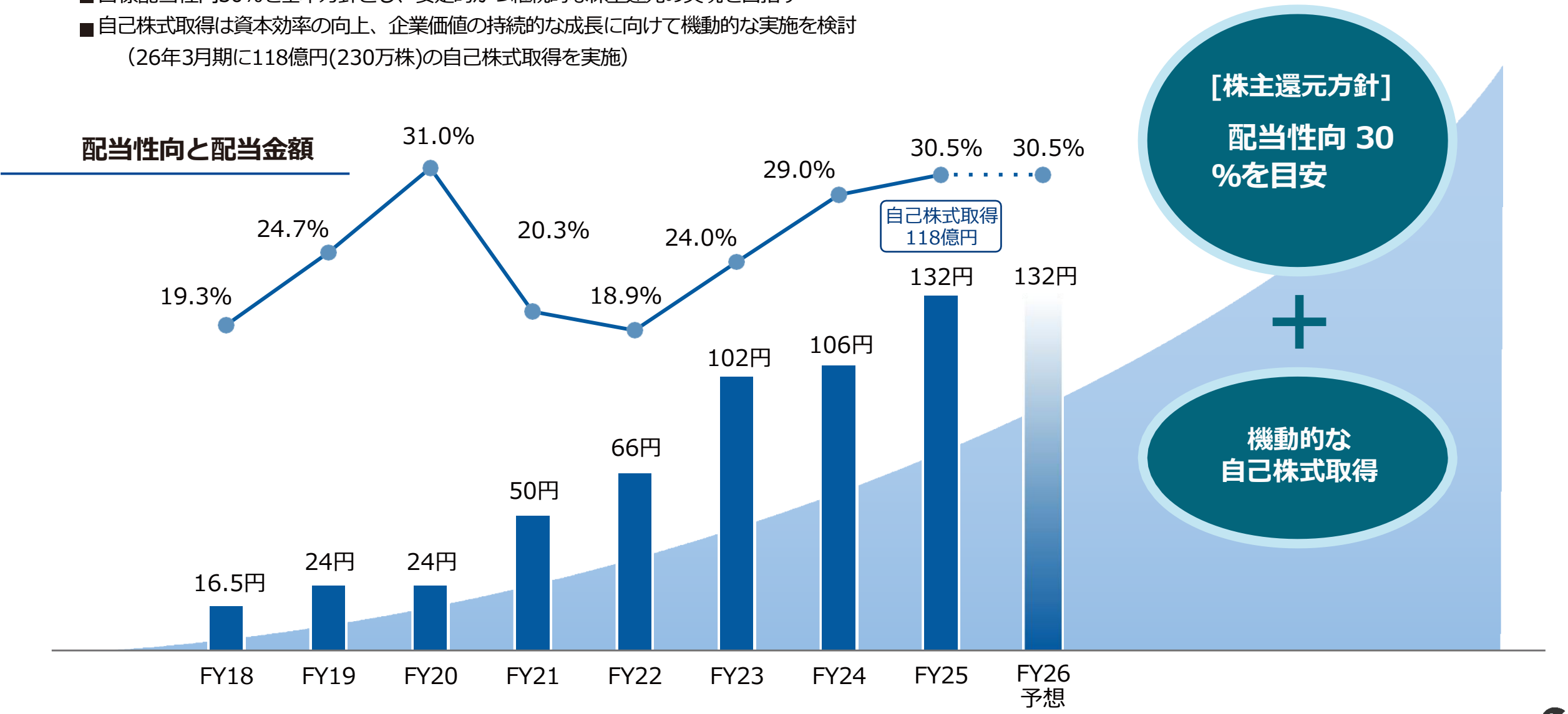


- 生産力・生産性の向上のための設備リニューアル
- 成長の期待できる半導体・ライフサイエンス領域への重点投資を実施
- 開発投資効率重視への転換
- 半導体、ライフサイエンス領域でのM&A機会探索
- 戦略投資の機会がない場合は、追加の株主還元を検討
- ニコンによる株式売却に伴う自己株式取得を実施(26年3月)
- 資本効率および企業価値の持続的向上に向けて、機動的な実施を検討
- 株主還元: 目標配当性向30%を目安

*医用機器事業の譲渡影響を反映

安定的かつ継続的な株主還元にむけた取組み

■目標配当性向30%を基本方針とし、安定的かつ継続的な株主還元の実現を目指す
■自己株式取得は資本効率の向上、企業価値の持続的な成長に向けて機動的な実施を検討
（26年3月期に118億円(230万株)の自己株式取得を実施）



資料取扱上のご注意

本プレゼンテーション資料及び弊社代表者が口頭にて提供する情報には、現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び所信に基づく記述が含まれています。今後、経済情勢をはじめ半導体市況や研究開発投資など、弊社の業績に影響を与える様々な既知または未知のリスクによって、ここに述べられている見通しと実際の結果が異なったものとなることが否定できないことを、ご承知置き願います。

© 2026 JEOL Ltd.